(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-255307

(43)公開日 平成4年(1992)9月10日

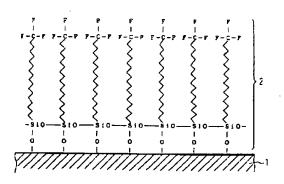
(51) Int.Cl. ⁵ B 2 9 C 33/38 B 0 5 D 1/18 B 2 8 B 7/38 B 2 9 C 33/60 B 3 2 B 9/00	識別記号	庁内整理番号 8927-4F 8616-4D 7351-4G 8927-4F 7365-4F	F l	技術表示箇所
	_		1	審査請求 未請求 請求項の数7(全 5 頁)
(21)出願番号	特願平3-38132		(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)2月	36日		大阪府門真市大字門真1006番地
			(72)発明者	小川 一文
				大阪府門真市大字門真1006番地松下電器産 業株式会社内
			(72)発明者	美濃 規央
				大阪府門真市大字門真1006番地松下電器産
				業株式会社内
			(72) 発明者	曽我 眞守
				大阪府門真市大字門真1006番地松下電器産
				業株式会社内
			(74)代理人	弁理士 池内 寛幸 (外1名)

(54) 【発明の名称】 成形用部材およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】フッ素を含む単分子膜からなる薄膜と、金型などの成形用部材の基材とを化学結合させて形成することにより、耐久性に優れ、防汚性と離型性に優れたものとする。

【構成】 金型などの基材表面の水酸基を利用し、一端に クロルシラン基を有する直鎖状炭素鎖を含むクロロシラン系界面活性剤を混ぜた非水系溶媒に接触させ、金型な どの表面の水酸基と前記クロロシリル基を複数個含む物 質のクロロシリル基を反応させて単分子膜を金型基材の 表面に化学結合により形成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材表面に薄膜が形成された成形用部材 であって、前配薄膜はフッ素を含む化学吸着単分子膜か らなり、かつ前記薄膜は基材と化学結合によって形成さ れてなることを特徴とする成形用部材。

【請求項2】 化学吸着単分子膜からなる薄膜が、基材 側に少なくともシロキサン系単分子膜が介在して形成さ れ、フッ素を含む基が表層側に位置している請求項1の 成形用部材。

成形用金型、射出成形用金型、トランスファー成形用金 型、真空成形用金型、吹き込み成形用金型、押し出し成 形用ダイ、インフレーション成形用口金、繊維紡糸用口 金、カレンダー加工用ロールから選ばれる請求項1また は2記載の成形用部材。

【請求項4】 成形用部材を洗浄した後、一端にクロル シラン基 (SiCl X₃- 基、n=1、2、3、Xは 官能基)を有し、他の一端にフッ化炭素基を有するクロ ロシラン系界面活性剤を溶かした有機溶媒を、前記部材 と接触させ、前記活性剤よりなる化学吸着単分子膜を前 20 記部材表面全体に亘り形成する工程を含むことを特徴と する成形用部材の製造方法。

【請求項5】 成形用部材を洗浄した後、クロロシリル 基を複数個含む物質を混ぜた非水系溶媒に接触させて、 前記部材表面の水酸基と前記クロロシリル基を複数個含 む物質のクロロシリル基とを反応させ、前記物質を前記 部材表面に析出させる工程と、非水系有機溶媒を用い前 記部材上に残った余分なクロロシリル基を複数個含む物 質を洗浄除去した後、水と反応させて、前記部材上にシ る工程と、一端にクロルシラン基(SiCl 3- 基、n=1、2、3、Xは官能基) を有し他の一端 に直鎖状フッ化炭素基を含むクロロシラン系界面活性剤 を前記部材上に化学吸着し単分子吸着膜を累積する工程 とを含むことを特徴とする成形用部材の製造方法。

【請求項6】 クロロシリル基を複数個含む物質として SiCl., statsiHCl3, SiH2 Cl2, C I-(SiCl₂O) -SiCl₃ (nは整数)を用 いる請求項4または5記載の成形用部材の製造方法。

直鎖状フッ化炭素基を含むクロロシラン系界面活性剤と UT, $CF_3 - (CF_2) - R - SiX$ C1 (nは0または整数、Rはアルキル基、エチレン 基、アセチレン基、Si-基または酸素原子を含む置換 基を表わすがなくとも良い、XはHまたはアルキル基等 の置換基、pは0または1または2)を用いる請求項4 または5記載の成形用部材の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、樹脂成形、各種窯業物 50 【0010】また本発明の第2番目の製造方法は、成形

体の成形やセラミックス成形等に用いられる金型等の成 形用部材に関するものである。さらに詳しくは、離型性 効果、撥水撥油効果、防汚効果、防錆効果等の高い高性 能成形用部材に関するものである。

[0002]

【従来の技術】樹脂成形、陶磁器などの各種窯業物体の 成形やセラミックス成形等には、プレス成形用金型、注 型成形用金型、射出成形用金型、トランスファー成形用 金型、真空成形用金型、吹き込み成形用金型、押し出し 【請求項3】 成形用部材が、プレス成形用金型、注型 10 成形用ダイ、インフレーション成形用口金、繊維紡糸用 口金、カレンダー加工用ロールなど多くの部材が用いら

> 【0003】従来、成形用部材の汚れを防止したり離型 性を向上するためには、表面をできるだけ滑らかにする か、シリコン系やフッ素系の離型剤を塗布するしか方法 がなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら前記従来 技術においては、離型剤を塗布しても長期間離型効果が あるわけではなく、ある一定の時間ないしはサイクルで 離型剤を塗布することが必要になる。したがって耐久性 に問題があるという課題があった。

【0005】本発明は、前記従来技術の課題を解決する ため、耐久性に優れ、汚れが付着しないか、付着しても 簡単に除去されるような防汚効果が高く離型性能の優れ た高性能成形用部材を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明の成形用部材は、基材表面に薄膜が形成され ラノール基を複数個含む物質よりなる単分子膜を形成す 30 た成形用部材であって、前記薄膜はフッ素を含む化学吸 着単分子膜からなり、かつ前記薄膜は基材と化学結合に よって形成されてなることを特徴とする。

> 【0007】前記構成においては、化学吸着単分子膜か らなる薄膜が、基材側に少なくともシロキサン系単分子 膜が介在して形成され、フッ素を含む基が表層側に位置 していることが好ましい。

【0008】前配構成においては、成形用部材が、プレ ス成形用金型、注型成形用金型、射出成形用金型、トラ ンスファー成形用金型、真空成形用金型、吹き込み成形 【請求項7】 一端にクロルシラン基を有し他の一端に 40 用金型、押し出し成形用ダイ、インフレーション成形用 口金、繊維紡糸用口金、カレンダー加工用ロール等を代 表的なものとして選ぶことができる。

> 【0009】本発明の第1番目の製造方法は、成形用部 材を洗浄した後、一端にクロルシラン基(SiCl X 3. 基、n=1、2、3、Xは官能基) を有し、他の一 端にフッ化炭素基を有するクロロシラン系界面活性剤を 溶かした有機溶媒を、前記部材と接触させ、前記活性剤 よりなる化学吸着単分子膜を前記部材表面全体に亘り形 成する工程を含むことを特徴とする。

3

【0011】また、前記第2番目の製造方法において、 クロロシリル基を複数個含む物質としてSiCl。、またはSiHCl。、SiH2Cl2、Cl-(SiCl2O) - SiCl3 (nは整数)を用いることが好ましい。

【0012】前記両製造方法において、一端にクロルシラン基を有し他の一端に直鎖状フッ化炭素基を含むクロ 20 ロシラン系界面活性剤として、CFs - (CF2) - R-SiX Cls (nは0または整数、Rはアルキル基、エチレン基、アセチレン基、Si-基または酸素原子を含む置換基を表わすがなくとも良い、XはHまたはアルキル基等の置換基、pは0または1または2)を用いることが好ましい。

[0013]

【作用】前記本発明によれば、薄膜はフッ素を含む化学吸着単分子膜を少なくとも含み、かつ前記薄膜は基材と化学結合によって形成されているので、耐久性に優れ、汚れが付着しないか、付着しても簡単に除去されるような防汚効果の高い離型性能の優れた高性能成形用部材とすることができる。また、きわめて薄いナノメータレベルの膜厚のフッ化炭素系単分子膜を成形用部材表面に形成するため、成形用部材本来の形状を損なうことがない。さらに、この薄膜はフッ化炭素系単分子膜は撥水鍛油性にも優れており、表面の防汚効果を高めることが可能となる。また、耐熱性も300℃以上ある。従って、撥水撥油防汚効果が高く離型性能の優れた高性能成形用部材を提供することができる。

【0014】また本発明方法は、前記薄膜を合理的に効率よく製造することができる。

[0015]

【実施例】一般の成形用部材は、金属であるため表面に水酸基を含む自然酸化膜がある。そこで、一端にクロルシラン基(SiCl X3- 基、n=1、2、3、Xは官能基)を有する直鎖状炭素鎖を含む分子、例えばフッ化炭素基及びクロロシラン基を含むクロロシラン系界面活性剤混ぜた非水系溶媒に接触させて前記成形用部材表面の水酸基と前記クロロシリル基を複数個含む物質のク 50

ロロシリル基を反応させて前記物質よりなる単分子膜を 前記成形用部材表面に折出させる、あるいはクロロシリ ル基を複数個含む物質を混ぜた非水系溶媒に接触させて 前記成形用部材表面の水酸基と前記クロロシリル基を複数個含む物質のクロロシリル基を反応させて前記物質を 前記成形用部材表面に析出させる工程と、非水系有機溶 媒を用い前記成形用部材表面に残った余分なクロロシリル基を複数個含む物質を洗浄除去し、前記成形用部材上にクロロシリル基を複数個含む物質よりなるシロキサン 系単分子膜を形成する工程と、一端にクロルシラン基を 有する直鎖状炭素鎖を含むシラン系界面活性剤を成形用 部材上に化学吸着し単分子吸着膜を累積する工程とにより成形用部材表面にフッ化炭素系化学吸着単分子累積膜 を形成できる。

【0016】以下に本発明に関する成形用部材として、プレス成形用金型、注型成形用金型、射出成形用金型、トランスファー成形用金型、真空成形用金型、吹き込み成形用金型、押し出し成形用ダイ、インフレーション成形用口金、繊維紡糸用口金、カレンダー加工用ロール等で代表される離型性の高い高性能部材があるが、代表例としてプレス用金型を取り上げ順に説明する。

【0017】実施例1

まず、加工の終了した鋼鉄性金型(Crメッキしてあっ ても同じ) 1を用意し(図1)、有機溶媒で洗浄した 後、フッ化炭素基及びクロロシラン基を含む物質を混ぜ た非水系の溶媒、例えば、CF₃ (CF₂), (C H₂)₂ SiCl₃ を用い、1%程度の濃度で溶かした 80%n-ヘキサデカン(トルエン、キシレン、ジシク ロヘキシルでもよい)、12%四塩化炭素、8%クロロ 30 ホルム溶液を調整し、前記金型を2時間程度浸渍する と、金型の表面は自然酸化膜が形成されており、その酸 化膜表面には水酸基が多数含まれているので、フッ化炭 素基及びクロロシラン基を含む物質のSICI基と前記 水酸基が反応し脱塩酸反応が生じ金型表面全面に亘り、 CFs (CF2) 7 (CII2) 2 Si (O-) 3 の結合 が生成され、フッ素を含む単分子膜2が金型の表面と化 学結合した状態でおよそ15オングストロームの膜厚で 形成できた。なお、単分子膜はきわめて強固に化学結合 しているので全く剥離することがなかった。なお、材質 40 の異なる金型、例えばアルミニウムやステンレス製で も、表面は自然酸化膜でおおわれていたので当然水酸基 が含まれおり、上述と同様の単分子膜を吸着時間を調整 するのみで同様の方法を用い形成できた。

【0018】この金型を用い実使用を試みたが、処理しないものに比べ汚物の付着を大幅に低減できた、またたとえ付着した場合にもブラシでこする程度で簡単に除去できた。また、離型剤を用い無くとも、離型性に全く問題はなかった。さらにまた、傷は全く付かなかった。また、油脂分汚れでも除去は水洗のみで可能であった。

50 【0019】実施例2

親水性ではあるが水酸基を含む割合が少ないステンレス 製金型の場合、トリクロロシリル基を複数個含む物質 (例えば、SiCla、またはSiHCla、SiH2 Cl2 Cl- (SiCl2 O) -SiCl3 (nt 整数)。特に、SiC1。を用いれば、分子が小さく水 酸基に対する活性も大きいので、企型表面を均一に親水 化する効果が大きい)を混ぜた非水系溶媒、例えばクロ ロホルム溶媒に1重量パーセント溶解した溶液に30分 間程度浸漬すると、ステンレス製金型表面11には親水 性のOH基12が多少とも存在するので(図3)、表面 10 程度の数が生成される。 で脱塩酸反応が生じトリクロロシリル基を複数個含む物 質のクロロシラン単分子膜が形成される。

【0020】例えば、トリクロロシリル基を複数個含む 物質としてSIC1。を用いれば、金型11表面には少 量の親水性のOH基が露出されているので、表面で脱塩 酸反応が生じ、下記

【化1】や

【化2】のように分子が-SiO-結合を介して表面に 固定される。

[0021]

【化1】

その後、非水系の溶媒例えばクロロホルムで洗浄し て、さらに水で洗浄すると、金型表面と反応していない SIC1。分子は除去され、金型表面に

0-

【化3】や

【化1】等のシロキサン単分子膜13が得られる(図

OH HO-SI-OH ı 0-

[0024] 【化4】

なお、このときできた単分子膜13は企型とは-Si 〇一の化学結合を介して完全に結合されているので剝が れることが全く無い。また、得られた単分子膜は表面に SiOH結合を数多く持つ。当初の水酸基のおよそ3倍

【0025】そこでさらに、フッ化炭素基及びクロロシ ラン基を含む物質を混ぜた非水系の溶媒、例えば、CF s (CF2) g (CH2) 2 SiCl3 を用い、1%程 度の濃度で溶かした80%n-ヘキサデカン、12%四 塩化炭素、8%クロロホルム溶液を調整し、前記表面に SiOH結合を数多く持つ単分子膜の形成された金型を 1時間程度浸漬すると、金型表面にCF3 (CF2) 9 (CH₂)₂ Si (O-)₃ の結合が生成され、フッ素 を含む単分子膜14が下層のシロキサン単分子膜と化学 20 結合した状態で金型表面全面に亘りおよそ15オングス トロームの膜厚で形成できた(図5)。なお、単分子膜 は剥離試験を行なっても全く剥離することがなかった。 【0026】さらにまた、上記実施例では、フッ化炭素 系界面括性剤としてCF3 (CF2)9 (CH2)2 S iCl3 を用いたが、アルキル鎖部分にエチレン基やア セチレン基を付加したり組み込んでおけば、単分子膜形 成後5メガラド程度の電子線照射で架橋できるのでさら

に単分子膜の硬度を向上させることも可能である。 【0027】なお、フッ化炭素系界面活性剤として上記 30 のもの以外にもCF₃ CH₂ O (CH₂)₁₅ SiC l_3 , CF_3 (CH_2) 2 S_i (CH_3) 2 (CH_2) 15 S i C l 3 、 F (C F 2) 8 (C H 2) 2 S i (C H 3) 2 (CH2) 9 SiCl3, CF3 COO (C H₂) 15 S i C l 3 等が利用できる。

【0028】以上実施例で説明した通り、きわめて薄い ナノメータレベルの膜厚のフッ化炭素系単分了膜を成形 用部材表面に形成するため、成形用部材本来の形状を損 なうことがない。また、このフッ化炭素系単分子膜は撥 水撥油性にも優れており、表面の防汚効果を高めること 40 が可能となる。従って、きわめて離型効果の高い高性能 成形用部材を提供することができる。さらにこのことに より、メンテナンスを大幅に削減できる効果も大きい。 また、耐熱性は、300℃以上あり、1万回以上の使用 でも離型性は劣化することがなかった。さらに本発明に おいては、適用できる成形用部材として、プレス成形用 金型、注型成形用金型、射出成形用金型、トランスファ 一成形用金型、真空成形用金型、吹き込み成形用金型、 押し出し成形用ダイ、インフレーション成形用口金、繊 維紡糸用口金、カレンダー加工用ロールなどを例示した 50 が、離型性効果を利用するものであればいかなる部材に

7

も応用することができる。

[0029]

【発明の効果】以上の通り本発明によれば、薄膜はフッ素を含む化学吸着単分子膜を少なくとも含み、かつ前記 薄膜は基材と化学結合によって形成されているので、耐久性に優れ、汚れが付着しないか、付着しても簡単に除去されるような防汚効果の高い離型性能の優れた高性能成形用部材とすることができる。また、きわめて薄いナノメータレベルの膜厚のフッ化炭素系単分子膜を成形用部材表面に形成するため、成形用部材本来の形状を損な 10うことがない。さらに、この薄膜はフッ化炭素系単分子膜は撥水撥油性にも優れており、表面の防汚効果を高めることが可能となる。また、耐熱性も300℃以上有る。従って、撥水撥油防汚効果が高く離型性能の優れた高性能成形用部材を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の成形用部材の代表的な例であるプレス

金型の斜視図である。

【図2】本発明のプレス金型の表面を分子レベルまで拡大した断面概念図である。

8

【図3】本発明の金型の第2の実施例を説明するために ステンレス製金型の表面を分子レベルまで拡大した断面 工程概念図である。

【図4】本発明の第2の実施例を説明するための金型の表面のシロキサン系単分子膜を分子レベルまで拡大した 断面工程概念図である。

0 【図5】本発明の第2の実施例を説明するための金型の 表面のフッ素系単分子膜を分子レベルまで拡大した断面 工程概念図である。

【符号の説明】

1…プレス金型、 2,14…単分子膜、 11…ステンレス製金型、 12…水酸基、 13…シロキサン単分子膜。

[図1] [図2] [図3] (図3] (図4] (図4] (図4]

